

磁控溅射卷绕镀膜设备

Roll-To-Roll Magnetron Sputtering
Vacuum Coating System



主要技术与性能指标

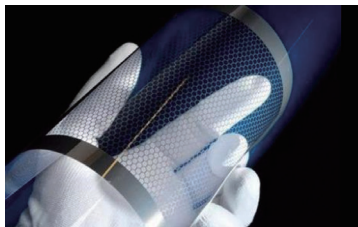
- 最大膜宽 1 350 mm、可镀膜宽度最大 1 250 mm、膜卷直径最大 400 mm、芯长最大 1 450 mm
- 极限压力（镀膜室内）约 5×10^{-4} Pa、膜层厚度均匀率 $\pm 3\%$ 、镀膜速度约 0.5—10 m/min
- 卷绕张力 0—500 N, 精度 $\pm 5\%$ 、卷绕速度范围 0.5—10 m/min、膜层跑偏量为来回 3 次 ≤ 5 mm
- 镀膜鼓温度控制范围 -10°C — $+40^{\circ}\text{C}$

主要应用

航空航天、光伏膜、半导体导电膜、汽车建筑玻璃膜、新型显示屏和触摸屏膜、新材料膜等柔性基底膜层

代表性应用成果

3C 产品中使用的透明导电薄膜、汽车
薄膜贴膜



主要用户单位	中国科学院上海硅酸盐研究所
研制单位	北京中科科仪股份有限公司、成都中科唯实仪器有限责任公司
联系方式	万红军 028-85121280, 13880623005 wanhj@cdzkws.com